PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-025138

(43)Date of publication of application: 25.01.2002

(51)Int.CL

G11B 11/105 G11B 7/24

(21)Application number: 2000-213180

(71)Applicant :

NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL &

TECHNOLOGY

SHARP CORP

TOMINAGA JUNJI

(22)Date of filing:

13.07,2000

(72)Inventor:

TOMINAGA JUNJI

KIN SHUKO

ATODA NOBUFUMI

FUJI HIROSHI

KATAYAMA HIROYUKI

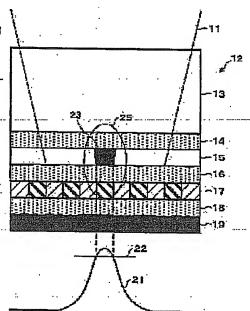
(54) OPTICAL RECORDING MEDIUM AND OPTICAL RECORDING AND REPRODUCING EQUIPMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical recording medium which suppresses the disappearance of a recording mark and enables repetitive reproduction and to provide an optical

recording and reproducing equipment.

SOLUTION: The optical recording medium has a substrate 13, a mask layer 15 formed on the substrate 13 and having a refractive index which is varied under light or heat and a recording layer 17 disposed above the mask layer 15 while leaving a smaller space than the reach of near-field light 25. The mask layer 15 forms a minute opaque region in a light beam spot and the recording layer 17 is a magneto-optical recording film. The optical recording and reproducing equipment uses the optical recording medium.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002—25138

(P2002-25138A)

(43)公開日 平成14年1月25日(2002.1.25)

(51) Int.CL	識別記号	· FI	ティコード (参考)
G11B 11/105	531	G11B 11/105	531N 5D029
			531V 5D075
	501		501Z
•	586		586L
7/24	538	7/24 .	538A
		零香請求 未請求	簡求項の数5 OL (全 9 頁)

(21) 出度番号	特質2000-213180(P2000-213180)		

平成12年7月13日(2000.7.13)

(71)出窟人 301021533

... 独立行政法人産業技術総合研究所...

東京都千代田区霞が関1-3-1

(74)上記1名の復代理人 100080034

弁理士 原 第三

(71)出題人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(71)出竄人 597136238

宫永 淳二

茨城県つくば市松代四丁目26-414-3

(74)上記2名の代理人 100080034

弁理土 原 改三

最終頁に続く

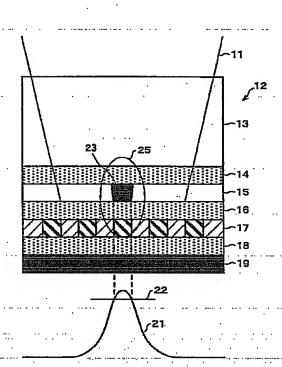
(54) 【発明の名称】 光記録媒体および光記録再生装置

(57)【要約】

(22)出廣日

【課題】 記録マークの消失を抑え、繰り返し再生が可能な光記録媒体および光記録再生装置を提供する。

【解決手段】 本発明の光記録媒体は、基板13と、基板13上に形成された光あるいは熱によって屈折率が変化するマスク層15と、該マスク層15と近接場光25の到達距離以下の間隔をおいて設けられた記録層17を備え、上記マスク層15は光ビームスボットの内に微小な不透明領域を生じ、上記記録層17は光磁気記録膜である。また、本発明の光記録再生装置は、上記構成の光記録媒体を用いている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 関値温度以上で屈折率が変化するマスク層 に対して近接場光の到達距離以下の間隔をおいて設けら れた記録眉を備えた光記録媒体において、

上記の記録層は磁性膜であることを特徴とする光記録媒

【請求項2】上記磁性膜が光磁気記録膜であることを特 徴とする請求項1に記載の光記録媒体。

【請求項3】上記マスク層は、酸化銀、酸化アンチモ ン、又は酸化テルビウムから成ることを特徴とする請求 10 項1又は2に記載の光記録媒体。

【請求項4】上記記録層の熱を発散させる熱発散層が更 に設けられたことを特徴とする請求項1、2、又は3に 記載の光記録媒体。

【請求項5】請求項1乃至4のいずれか一つに記載の光 記録媒体を使用し、

上記光記録媒体の温度を上昇させる温度上昇手段と、 再生時には記録時より上記温度上昇が低く、且つ、上記 記録屋の磁化に影響を与えないように、上記温度上昇手 段を制御する温度制御手段と、

記録時に、記録情報に応じて変化する記録磁界を発生 し、該記録磁界を上記光記録媒体に印加する磁界発生手

上記光記録媒体からの反射光または透過光の偏光成分を 検出して情報を再生する再生手段とを備えている光記録 再生装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]-----

【発明の属する技術分野】本発明は、近接場光を使用し および光記録再生装置に関するものである。

[0002].

【従来の技術】近年、近接場光を用いての高密度記録を 行うために種々の方式が開発されている。例えば、Japa nese Journal Applied Physics, vol.39(2000), Part 1. No.2B. pp.980-981には、近接場光を使用した光メモ リの読み取り方法および書き込み方法が開示されてい る。この技術について、図4を参照しながら、以下に説 明する。

【0003】図示しない対物レンズを介して集光された 40 光ビーム (レーザビーム) 101は、光ディスク102 に照射される。光ディスク102は、ディスク基板11 1上に、保護層112、マスク層113、保護層11 4、記録層115、保護層116の順に成膜されてい…… る。これら各層の厚みは、ディスク基板111か0.6 mm、保護暦112が170nm、マスク暦113が1 5 nm、保護層 1 1 4 が 4 0 nm、記録層 1 1 5 が 1 5 · · · · · 【0 0 1 1】情報の再生は次のようにして行われる。す · · · · nm、保護層116が20nmである。

【0004】上記記録層115として、相変化型の材料 であるGez-Sbz-Te,を使用し、上記マスク居11--50-屈折率が変化した部分の周囲に近接場光が発生する。記

3として、酸化銀膜を使用している。照射された光ビー ム101によって、上記マスク層113には、図1に示 すような温度分布117が生じる。

【0005】上記温度分布117において関値温度11 8を越えた光ビームスポットの中心部分では、酸化銀が 分解し、銀が折出する。この銀の折出によって、該部分 の屈折率が変化し、マスク居113に光ビームスポット 径よりも小さな散乱体103が形成され、この周囲に近 接場光105が発生する。この近接場光105と、相変 化により記録膜115に記録されたマーク104との相 互作用により伝接光が生じ、その一部を反射光として読 み出す。保護屋114の厚みは、散乱体103によって 発生した近接場光105が記録層115に到達する距離 以下に設定されている。これにより、100 nm以下の 記録マークを記録あるいは再生する。

[0000]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来の技術は、マスク層113と記録層115との間隔が 狭く、その結果、熱的な干渉が生じて相変化が起とり、

20 これにより、記録マークが消失してしまうという問題点 があった。

【0007】つまり、マスク層113に散乱体103を 形成するためには、マスク層113の温度を閾値温度1 18以上に上げる必要があるが、マスク層113と記録 居115との間隔が狭く、その熱が記録層115に伝わ りやすい。その結果、記録マーク104以外の部分も相 変化して結晶化され、記録信号が次第に消失するという 問題点があった。

【0008】本発明は、上記問題点に鑑みなされたもの て光の回折限界を越えた記録密度を実現する光記録媒体 30 であり、その目的は、記録マークの消失を回避し、しか も、繰り返し再生が可能な光記録媒体および光記録再生 装置を提供することにある。

[0009]

. 【課題を解決するための手段】本発明に係る光記録媒体 は、上記課題を解決するために、関値温度以上で屈折率 が変化するマスク層に対して近接場光の到達距離以下の 間隔をおいて設けられた記録層を備え、上記の記録層が 磁性膜であることを特徴としている。

【0010】上記の発明によれば、記録層が磁性膜であ るので、磁気的に情報の記録が行われる。したがって、 マスク層と記録層との間隔が狭く、その結果、熱的な干 渉が生じても、磁性膜の記録情報は影響を受けない。つ まり、磁界が印加されない限り、磁性膜の記録情報は変 化することはない。これにより、記録層の記録情報が次 第に消失してしまうという従来の問題点を確実に克服で

なわち、マスク層において温度が上昇すると、温度上昇 部分であって関値温度以上の部分は、屈折率が変化し、

録層がマスク層に対して近接場光の到達距離以下の間隔 をおいて設けられているので、この近接場光は記録層と 相互作用して散乱され、この散乱光 (伝振光) の一部が 反射光として反射される。この反射光に基づいて、情報 の再生が行える。

[0012]なお、上記上昇部分の温度が上記段値温度 より低くなると、上記マスク層において上記屈折率が変 化していた部分は、もとの屈折率に戻る。このようにマ スク層の温度上昇部分を移動させると、それに追従して 屈折率の変化する部分が移動し、その結果、繰り返して 近接場光による再生が可能となる。

【0013】上記遊性膜は光磁気記録膜であることが好 ましい。この場合、情報の記録は次のようにして行われ る。すなわち、記録部分の温度を上昇させ、光磁気記録 膜の保磁力を略ゼロにし、外部磁界を印加させて、記録 部分の磁化の向きを反転することによって情報の記録が 行われる。

[0014]また、情報の再生の際にも、マスク層と記 録層との間隔が狭く、その結果、熱的な干渉が生じて 情報は変化することはない。つまり、たとえ再生時に記 録層の温度が上昇しても、外部磁界が印加されない限 り、記録部分や、それ以外の部分の磁化反転が生じない ため、記録情報が次第に消失することを確実に回避でき

【0015】上記マスク層は、酸化銀あるいは酸化アン チモンあるいは酸化テルビウムから成ることが好まし い。これらは、何れも、例えばスパッタ等によって容易 に成膜できるため、量産性に優れている。また、これら は、関値温度以上で化学分解することによって金属が析。30 出し、高速で散乱効率の高い散乱体を形成することが可 能となる。また、透明な開口が形成されるものに比べ て、高いCNRを得ることが可能となる。

【0016】上記記録層の熱を発散させる熱発散層が更 に設けられていることが好ましい。この場合、記録局の 熱が熱発散層によって発散されるので、記録層の温度上 昇が抑えられる。これにより、記録層の記録情報がより 消失しにくくなる。

【0017】本発明に係る光記録再生装置は、上記課題 を解決するために、上記いずれか一つに記載の光記録媒 40 体を使用し、上記光記録媒体の温度を上昇させる温度上 昇手段と、再生時には記録時より上記温度上昇が低く、 且つ、上記記録層の磁化に影響を与えないように上記温 度上昇手段を制御する温度制御手段と、記録時に、記録 情報に応じて変化する記録磁界を発生し、該記録磁界を 上記光記録媒体に印加する磁界発生手段と、上記光記録 媒体からの反射光または透過光の偏光成分を検出して情--報を再生する再生手段とを備えていることを特徴として

【0018】上記の発明によれば、磁性膜の所望の部分 -- 50 -- 録媒体)は、図1に示すように、基板(例えば、ポリカ ---

に磁界発生手段から磁界が印加されることによって記録 が行われる。一方、再生時には、記録時よりも低い温度 上昇となるように、温度上昇手段が温度制御手段によっ て制御される。この際、上記記録層の磁化は、上記温度 上昇によって影響を受けない。この温度上昇の結果、上 記閾値温度以上の領域では、屈折率が変化し、屈折率が 変化した部分の周囲に近接場光が発生する。記録層がマ スク層に対して近接場光の到達距離以下の間隔をおいて 設けられているので、この近接場光は記録層と相互作用 して散乱され、この散乱光(伝微光)の一部が反射光と して反射される。この反射光の偏光成分が、再生手段に よって検出されて、情報が再生される。との反射光の代 わりに透過光を検出して、情報を再生してもよい。再生 中は、磁界発生手段から磁界が光記録媒体に対して印加 されることはない。....

【0019】ところで、上記磁性膜が光磁気記録膜であ

る場合、温度上昇手段によって光記録媒体の温度が上昇 されると、記録層において保磁力が略ゼロになる部分が 生じ、この部分に磁界発生手段から磁界が印加されると も、外部磁界が印加されない限り、光磁気記録膜の記録 20% とによって上記部分の磁化が反転し、記録が行われる。 【0020】とれに対して、再生時は、次のような処理 が行われる。すなわち、記録時よりも低い温度上昇とな るように、温度上昇手段が温度制御手段によって制御さ れる。との際、上記記録層の磁化は、上記温度上昇によ って影響を受けない。温度上昇の結果、関値温度以上の 領域では、屈折率が変化し、屈折率が変化した部分の周 囲に近接場光が発生する。記録層がマスク層に対して近 接場光の到達距離以下の間隔をおいて設けられているの で、この近接場光は記録層と相互作用して散乱され、と の散乱光 (伝揚光) の一部が反射光として反射される。 との反射光に基づいて、情報の再生が行われる。再生中 は、磁界発生手段から磁界が光記録媒体に対して印加さ れることはない。

【0021】したがって、上記の光記録再生装置によれ ば、マスク居と記録居との間隔が狭く、その結果、熱的 な干渉が生じても、再生動作中は、記録層の磁化が温度 上昇によって影響を受けないと共に磁界が磁界発生手段 から光記録媒体に印加されないので、記録層の記録情報 が変化することはない。つまり、たとえ再生時に記録層 の温度が上昇しても、記録層の磁化が温度上昇によって 影響を受けないと共に磁性膜に磁界が印加されないの で、記録部分や、それ以外の部分において磁化反転が生 じないため、記録情報が次第に消失することを確実に回 遊できる。

[0022]

【発明の実施の形態】本発明の実施の一形態について図 1万至図3に基づいて説明すれば、以下のとおりであ

【0023】本実施の形態に係る光ディスク12(光記…

ーボネート基板) 13上に、第1保護層14、マスク層 15、第2保護層16、記錄層17、第3保護層18、 及び反射層19が、この順に成膜されている。

[0024]上記の第1保護層14、第2保護層16、 及び第3保護層18には誘電体膜(ZnS-SiOz) を使用する。上記の記録層17としてTbFeCo等の 光磁気記録膜を使用し、マスク層15として酸化銀膜 (AgOx)を使用する。上記の反射層19として銀の 薄膜を使用する。

[0025]上記の第1保護層14の膜厚は60ヵmで 10 あり、上記マスク層15の膜厚は15 nmであり、上記 の第2及び第3保護層16及び18の膜厚はそれぞれ2 5nmであり、上記の記録層17の膜厚は25nmであ り、上記の反射層19の膜厚は50nmである。

_【0026】上記の記録層17は、一例として光磁気記 録膜を挙げたが、本発明はこれに限定されるものではな く、磁性膜であればよい。また、本発明は、上記の記録 層17の厚みも上記例示のものに限定されない。その他 の各層の上記膜厚及び上記材料についても、これらは、 あくまでも一例であり、本発明はこれらの厚み及び材料 20 に限定されるものではない。

【0027】 ここで、上記構成を有する光ティスク12 におけるマスク層15の動作について、説明する。図1 に示すように、対物レンズ (図示しない) を介して集光 された光ビーム11(レーザビーム)が照射されると、 照射された光ビーム11によってマスク層15には温度 分布21が生じる。

・【0028】マスク層15に使用されている酸化銀膜・ は、光ビームスポット (レーザスポット) の中心付近で あって関値温度22を越えた部分において、酸素と銀に、30.4【0034】図1は、反射局19が設けられた光ディス。 分解され、銀が折出する。これによって、その部分の屈 折率が高速で変化し、マスク層15には光ビームスポッ ト径よりも小さな散乱体23が形成され、その周囲に近 接場光25が発生する。

【0029】記録層17がマスク層15に対して近接場 光25の到達距離以下の間隔をおいて設けられているの で、この近接場光25は記録層17と相互作用して散乱 され、この散乱光(伝搬光)の一部が反射光として読み 出される。

【0030】また、光ディスク12は後述の通りスピン 40 層に酸化銀を使用した場合の本発明に係る光ディスク ドルモータ44 (図3参照) によって回転され、光ビー ム11が光ディスク12上を走査する。光ピーム11が 照射された部分においては、上述のとおり、酸化銀は、 される一方、光ビーム11が移動し、上記部分が照射さ れなくなると、上記部分の温度が低下し、これにより、 転によって光ディスク12上を光ビーム11が移動する と、光ビーム1.1に追従して散乱体23の形成部分は移

可能となる。

【0031】上記の説明においては、光ピーム11の光 量は再生光量であり、記録層17の磁化を略ゼロにさせ る記録光量よりも量が少なく、上記記録届17の強化に 影響を与えない程度の光量である。

【0032】本実施の形態においては、上記の記録層1 7として光磁気記録膜が使用されており、記録マーク2 7の記録時には光ビーム11の光量を記録光量(記録層 17の記録部位の磁化を路ゼロにさせる光量)まで高 め、磁化が路ゼロになった記録部位に対して外部磁界を 印加して、該記録部位の磁化を反転させて記録してい る。したがって、記録に際して、光ビーム11の照射に よる温度の上昇以外に、外部磁界が別途必要となる。 【0033】以上のように、上記光ディスク12によれ は、記録時には外部磁界が印加され、再生時には記録層。 17の磁化の向きが影響を受けない程度の光量の再生光 ビームが照射されると共に外部磁界(記録できない程度 の磁界強度を有する)を弱めるか、或いはゼロにすると とによって、記録時には記録マーク (記録情報) を記録 し、再生時には磁化反転を防ぎ、記録マークが次第に消 失することを防止することが可能となる。なぜなら、再 生時にはマスク層15が再生温度まで上昇し、その熱に よって記録層17の温度もある程度上昇するが、温度上 昇部分の保持力は外部磁界によって磁化の向きが反転す るほど小さくならず、しから、外部磁界がほぼゼロであ るため、磁化の向きが反転することを確実に防止できる からである。 との際、反射層19は、熱の拡散を促進 し、さらに再生時の記録層17の温度上昇を抑える働き がある。

ク12を示しているが、本発明は、これに限定されるも のではなく、との反射層19が設けられていない構成で もよい。この場合、熱の拡散を促進する点、及び再生時 の記録層17の温度上昇を抑える働きを有する点におい て、反射層19が設けられた構成よりも劣るが、前述の ように、記録マーク27以外の部分における記録信号の 消失を回避し、しかも、繰り返し再生が可能な光記録媒 体を提供できる。

[0035]図2には、記録層に磁性膜を使用しマスグ と、他の2種類の光ディスク(記録層に相変化材料を使 用しマスク層にアンチモンを使用した場合の従来の光デ ィスクと、マスク層がない従来の光ディスクの2種類) 保護層14と保護層16に挟まれたまま酸素と銀に分解・・・・とにおいて、C/N比 (Carrier to Noise Ratio)のマ ーク長依存性をそれぞれ測定したものである。 使用した 光ビーム (レーザビーム) の波長は680 nm、対物レ 酸素と銀は、元の酸化銀に再結合する。したがって、回・・・・ンズの開口数は0.55、光ティスクと光ビームスポッ・・・・・ トの相対線速度は3.0m/sであった。光記録密度の 限界を〔波長/(4×開口数)〕とすると、約310n

【0036】記録層に相変化材料を使用しマスク層にア ンチモンを使用した従来の光ディスクの場合は、上記限 界(約310mm)を越える短い記録マーク(高密度の 記録マーク)を再生することができなかった。これは、 アンチモンをマスク層に使うと、室温では反射率が高 く、光ビームスポットを照射すると、中心の高温部分に おいて透明な開口が生じるからである(例えば、論文誌 Applied Physics Letters, vol. 73, no. 15, 12 Octo ber 1998, pp. 2078-2080 参照)。 この方式は透明な開 口を形成する方式であるのに対し、本発明は散乱体(上 10 記散乱体23)を形成する方式であり、両者は全く異な る方式である。

【0037】また、マスク層が無い従来の光ディスクの 場合は、幾分短い(幾分密度の高い)記録マークが再生 できているが、アンチモンを使用した上記従来の光ティ…… スクの場合と同様に、光記録密度の上記限界(約310 nm) を超えることはできなかった。

[0038] これに対して、記録層に磁性膜を使用しマ スク層に酸化銀を使用した本発明の光ディスクの場合 い(密度の高い)記録マークを再生することができた。 つまり、前述のように、透明な開口を生じるマスク層を 用いた従来の光ディスクやマスク層が無い従来の光ディ スクの場合に比べて、マスク層に領小散乱体を生じる本 発明に係る光ディスクは、格段に記録密度を向上させる ことができる。

【0039】図1において、各層の厚みは、前述のよう に、ディスク基板13が0.6mm、第1保護層14が 60 nm、マスク層15が15 nm、第2保護層16が 25 nm、記録層17が25 nm、第3保護層16が2-30 の磁化状態を変化させるにいたらない光量を意味する。 5nm、反射層20が50nmであり、特に、第2保護 屋16の厚みは、近接場光25が記録層17に到達する 距離に設定されている。

【0040】具体的には、上記第2保護層16の厚みと しては、10nm~100nmが適していた。この厚み は、光ビームの波長を入、各保護層の屈折率をn、a .(1/30~1/3)を定数とし、第2保護層16の厚 みをdとすると、 $d = a \times \lambda / n$ を満足するように設定

【0041】上記マスク層15の材料は、酸化銀に限ら ず、酸化アンチモン、酸化テルビウムなどの他の材料と しても良い。これらは、何れも、例えば、スパッタ等に よって容易に成膜できるため、量産性に優れている点で 好ましい。また、これらは、閾値温度以上で化学分解す。 るととによって金属が析出し、高速で散乱効率の高い散 乱体を形成することが可能となる。また、透明な開口が 形成されるものに比べて、高いCNRを得ることが可能・

や上記の記録層17を破壊することを防ぐプロテクター の役目も合わせ持っている。これによって、マスク層1 5において安定した散乱体23を形成することができ

【0043】 ここで、図3を参照しながら、上記光ティ スク12に情報を記録再生する光記録再生装置について 以下に説明する。

【0044】 この光記録再生装置は、図3に示すよう に、記録回路31からの記録信号がレーザ駆動回路32 に送られ、ことで駆動電流が生成され、光学ピックアッ プ内の半導体レーザ33に送られる。この半導体レーザ 33では、上記駆動電流に応じて変化する記録光ビーム がビームスブリッタ38及び対物レンズ34を介してト ラッキング及びフォーカシングされて光ディスク12上 に集光される......

[0045] これと同時に、記録時は、磁気ヘッド駆動 回路41から、記録情報に応じて変化する磁気ヘッド駆 動信号が磁気ヘッド42に送られ、ここで上記磁気ヘッ ド駆動信号に応じて変化する磁界が発生する。この磁界 は、光記録密度の上記限界(約310 nm)を越える短 20 は、光ディスク12 に印加され、光ディスク12 の記録 層17において記録光ビームが照射された部分であって 保磁力が路ゼロになった部分の磁化の向きを反転させ、 これによって、情報が記録される。

> 【0046】これに対して、再生時は、まず、磁気へっ F42からの世界をゼロあるいは減少させ、弱い光量の 再生光ピームをピームスプリッタ38及び対物レンズ3 4を介してトラッキング及びフォーカシングして光ディ スク12上に照射する。ここで、上記の弱い光量とは、 上記記録層17において再生光ビームが照射された部分 【0047】この際、マスク層15において再生光ビー ムが照射された部分には、温度分布21が生じる(図1 参照)。マスク層15に酸化銀膜が使用されている場 合、再生光ビームスポットの中心付近であって関値温度 22を越えた部分において、酸化銀は酸素と銀に分解 し、銀が析出する。これにより、その析出部分の屈折率 が変化し、マスク層15には再生光ピームスポット径よ りも小さな散乱体23が形成され、その周囲に近接場光 25が発生する。この近接場光25は記録層17(記録 マーク27)と相互作用して散乱され、この散乱光(伝 搬光)の一部が反射光として、ビームスプリッタ38、 対物レンズ34、及び偏光素子35を介してフォトディ テクタ36に送られる。そして、フォトディテクタ36 で電気信号に変換された後、再生回路37に送られ、こ とで、記録情報が再生される。

【0048】なお、上記光ディスク12は、スピンドル --モータ44 (図3参照) によって回転され、再生光ビー ムが光ディスク12上を走査し、再生光ピームが照射さ 【0042】また、第1保護暦14および第2保護暦1 れた部分(関値温度以上の部分)においては、上述のと 6は、マスク層 1.5 の酸化銀の化学変化が上記基板 1 3 50 おり、酸化銀は、第 1 保護層 1.4 と第 2 保護層 1.6 に挟 まれたまま酸素と銀に分解されると共に、再生光ビーム が移動し、上記部分が照射されなくなると、該部分の温 度が低下し、これにより、元の酸化銀に再結合する。こ のように、回転によって光ディスク12上を再生光ビー ムが移動すると、再生光ビームに追従して散乱体23の 形成部分は移動し、その結果、繰り返して近接場光25 による再生が可能となる。

【0049】上配光記録再生装置においては、光量の課 整は、レーザ駆動回路32にて行われ、マスク層15に れる。回転制御回路43から送られた制御信号はスピン ドルモータ44に送られ、光ディスク12を所定の回転 数で回転させる。本実施の形態においては、線速度が、 例えば、2m/s~16m/sの範囲となるように回転 数を制御すると、情報の記録・再生が行えた。

【0050】さて、近年、青色半導体レーザを使用した 記録再生が研究されている。レーザ光源の波長を短くす ることにより、高密度記録を行うものである。しかし、 本実施の形態で使用されている磁性膜TbFeCoは、 青色半導体レーザの波長帯(500mm以下)では、急 20 小な不透明領域を生じ、前記記録層は磁性膜である光デ 激に信号量が低下する。これはカー回転角が波長依存性 を持つためである。そとで、本発明の構成を青色半導体 レーザに適用するために、例えば、TbFeCoの磁性 膜に近接してGdFeCoの磁性膜を配置する。反射光 によって記録再生する場合は、TbFeCoの磁性膜よ りも光源側にGdFeCoの磁性膜を配置する。このG dFeCoの磁性膜は、TbFeCoの磁性膜に記録さ れた記録マークを転写する効果があり、また、青色半導 体レーザの波長においても大きなカー回転角が得られ る。したがって、GdFeCoの磁性膜に転写された記.30. 録マークをマスク層に発生した散乱体を介して青色半導 体レーザによって再生すれば、より高密度の記録再生が 可能となる。なお、本発明は、上記材料に限定されるも のではなく、保磁力や磁気異方性が高い磁性膜(本例で はTbFeCo〉、短波長において磁気光学効果が大き い磁性膜(本例ではGdFeCo)を使用すればよい。 【0051】本発明の第1光記録媒体は、以上のよう に、基体と、該基体上に形成した光あるいは熱によって 屈折率が変化するマスク層と、該マスク層と近接場光の 到達距離以下の間隔をおいて設けられた記録層を備える 光記録媒体において、前記マスク層は光スポットの内に 微小な不透明領域を生じ、前記記録層は磁性膜であると とを特徴としている。

【0052】上記第1光記録媒体によれば、たとえ再生・ 時に記録層の温度が上昇しても、記録マークや、それ以 外の部分の磁化反転が生じないため、記録マークの消失

【0053】本発明の第2光記録媒体は、以上のよう 化銀あるいは酸化アンチモンあるいは酸化テルビウムか...50 して検出することによって、情報の再生が行える。

ら成ることを特徴としている。

【0054】上記第2光記録媒体によれば、酸化銀ある いは酸化アンチモンあるいは酸化テルビウムが化学分解 することによって金属が折出し、高速で散乱光率の高い 散乱体を形成することが可能である。また、透明な開口 が形成される方式に比べて、高いCNRを得ることがで きる。

【0055】本発明の第3光記録媒体は、以上のよう に、上記の第1光記録媒体において、前記マスク層と前 おいて散乱体23を適切に形成するように光量が制御さ 10 記記録唇を隔てて、光ビームの入射面とは反対側に反射 層を備えることを特徴としている。

> 【0056】上記第3光記録媒体によれば、記録層の熱 を速やかに拡散させ、記録マークの消失をさらに抑える ことが可能である。

> -【0057】本発明に係る光記録再生装置は、以上のよ うに、ディスク基板と、該ディスク基板上に形成した光 あるいは熱によって屈折率が変化するマスク層と、該マ スク層と近接場光の到達距離以下の間隔をおいて設けら れた記録層を備え、前記マスク層は光スポットの内に微 ィスクを使用し、前記ディスクを回転させる回転手段 と、光ビームを前記ディスク基板に集光する光学手段 と、前記微小な不透明領域形成するための光ビームの光 **量制御手段と、前記ディスクからの反射光または透過光** の偏光成分を検出して情報を再生する再生手段を備える てとを特徴としている。

> 【0058】上記の光記録再生装置によれば、たとえ再 生時に記録層の温度が上昇しても、外部印加磁界をオフ することによって、記録マークや、それ以外の部分の磁 化反転が生じないため、記録マークの消失を抑えること が可能である。

[0059]

【発明の効果】本発明に係る光記録媒体は、以上のよう に、関値温度以上で屈折率が変化するマスク層に対して 近接場光の到達距離以下の間隔をおいて設けられた記録 層を備え、上記の記録層が磁性膜であることを特徴とし ている。

【0060】上記の発明によれば、記録層が磁性膜であ るので、磁気的に情報の記録が行われる。したがって、 マスク層と記録層との間隔が狭く、その結果、熱的な干 渉が生じても、磁性膜の記録情報は影響を受けない。つ まり、磁界が印加されない限り、磁性膜の記録情報は変 化することはない。これにより、記録層の記録情報が次 第に消失してしまうという従来の問題点を確実に克服で きるという効果を奏する。

【0061】情報の再生は、記録層がマスク層に対して 近接場光の到達距離以下の間隔をおいて設けられている。 ととにより生じる近接場光が、記録層との相互作用によ に、上記の第1光記録媒体において、前記マスク層が酸 って散乱され、この散乱光(伝搬光)の一部を反射光と

[0062]なお、上記上昇部分の温度が上記買値温度 より低くなると、上記マスク層において上記屈折率が変 化していた部分は、もとの屈折率に戻る。このようにマ スク層の温度上昇部分を移動させると、それに追従して 屈折率の変化する部分が移動し、その結果、繰り返して 近接場光による再生が可能となる。

【0063】上記磁性膜は光磁気記録膜であることが好 ましい。との場合、情報の記録は次のようにして行われ る。すなわち、記録部分の温度を上昇させ、光磁気記録 膜の保磁力を略ゼロにし、外部磁界を印加させて、記録 部分の磁化の向きを反転することによって情報の記録が

[0064]また、情報の再生の際にも、マスク層と記 録層との間隔が狭く、その結果、熱的な干渉が生じて も、外部産界が印加されない限り、光磁気記録膜の記録 情報は変化することはない。つまり、たとえ再生時に記 録層の温度が上昇しても、外部磁界が印加されない限 り、記録部分や、それ以外の部分の磁化反転が生じない ため、記録情報が欠第に消失することを確実に回避でき るという効果を併せて奉する。

【0065】上記マスク層は、酸化銀あるいは酸化アン チモンあるいは酸化テルビウムから成ることが好まし い。これらは、何れも、例えばスパッタによって容易に 成膜できるため、重産性に優れている。また、これら は、関値温度以上で化学分解することによって金属が折 出し、高速で散乱効率の高い散乱体を形成することが可 能となる。また、透明な開口が形成されるものに比べ て、高いCNRを得ることが可能となるという効果を併 せて奏する。

に設けられていることが好ましい。この場合、記録層の 熱が熱発散層によって発散されるので、記録層の温度上 昇が抑えられる。これにより、記録層の記録情報がより 消失しにくくなるという効果を併せて奏する。

【0067】本発明に係る光記録再生装置は、上記課題 を解決するために、上記いずれか一つに記載の光記録媒 体を使用し、上記光記録媒体の温度を上昇させる温度上 昇手段と、再生時には記録時より上記温度上昇が低く、 且つ、上記記録層の磁化に影響を与えないように上記温 度上昇手段を制御する温度制御手段と、記録時に、記録 40 選できるという効果を併せて奏する。 情報に応じて変化する記録磁界を発生し、該記録磁界を 上記光記録媒体に印加する磁界発生手段と、上記光記録 媒体からの反射光または透過光の偏光成分を検出して情 報を再生する再生手段とを備えていることを特徴として

[0068]上記の発明によれば、磁性膜の所望の部分 に磁界発生手段から磁界が印加されることによって記録・・・・・・【図3】本発明の光記録再生装置の構成例を示すブロッ が行われる。一方、再生時には、記録時よりも低い温度 上昇となるように、温度上昇手段が温度制御手段によっ て制御される。この際、上記記録層の磁化は、上記温度 -50。る。----

上昇によって影響を受けない。この温度上昇の結果、上 記
国
値
温
度
以
上
の
領
域
で
は
、
屈
折
率
が
変
化
し
、
屈
折
率
が 変化した部分の周囲に近接場光が発生する。記録層がマ スク層に対して近接場光の到達距離以下の間隔をおいて 設けられているので、この近接場光は記録層と相互作用 して散乱され、との散乱光 (伝接光) の一部が反射光と して反射される。この反射光に基づいて、情報の再生が 行われる。再生中は、磁界発生手段から磁界が光記録媒 体に対して印加されることはない。

【0069】ところで、上記磁性膜が光磁気記録障であ る場合、温度上昇手段によって光記録媒体の温度が上昇 されると、記録層において保磁力が略ゼロになる部分が 生じ、この部分に磁界発生手段から磁界が印加されると とによって上記部分の磁化が反転し、記録が行われる。 【0070】 これに対して、 再生時は、 次のような処理 が行われる。すなわち、記録時よりも低い温度上昇とな るように、温度上昇手段が温度制御手段によって制御さ れる。この際、上記記録層の磁化は、上記温度上昇によ って影響を受けない。温度上昇の結果、関値温度以上の 20 領域では、屈折率が変化し、屈折率が変化した部分の周 囲に近接場光が発生する。記録層がマスク層に対して近 接場光の到達距離以下の間隔をおいて設けられているの で、この近接場光は記録層と相互作用して散乱され、こ の散乱光(伝搬光)の一部が反射光として反射される。 この反射光の 偏光成分が、 再生手段によって検出され て、情報が再生される。この反射光の代わりに透過光を 検出して、情報を再生してもよい。再生中は、磁界発生 手段から磁界が光記録媒体に対して印加されることはなっ

- 【0066】上記記録層の熱を発散させる熱発散層が更 --30 --【007-1】したがって、--上記の光記録再生装置によれ--ば、マスク層と記録層との間隔が狭く、その結果、熱的 な干渉が生じても、再生動作中は、記録層の磁化が温度 上昇によって影響を受けないと共に磁界が磁界発生手段 から光記録媒体に印加されないので、記録層の記録情報 が変化することはない。つまり、たとえ再生時に記録層 の温度が上昇しても、記録層の磁化が温度上昇によって 影響を受けないと共に磁性膜に磁界が印加されないの で、記録部分や、それ以外の部分において磁化反転が生 じないため、記録情報が次第に消失することを確実に同

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る光記録媒体の構成例を示す説明図

[図2] 本発明の光記録媒体と、その他の光記録媒体と において、C/N比のマーク長依存特性の測定結果を示 す説明図である。

ク図である。

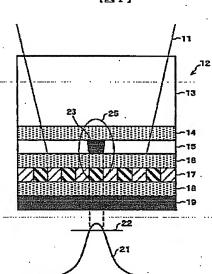
【図4】従来の光記録媒体の構成例を示す説明図であ

【符号の説明】

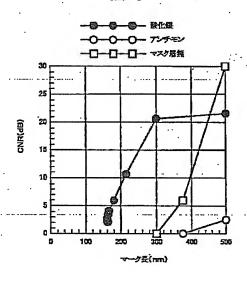
- 12 光ディスク (光記録媒体)
- 13 基板
- 14 保護層
- 16 保護層
- 18 保護層
- 15 マスク層
- 17 記録層(磁性層)

- *19 反射層
 - 22 閾値温度
 - 23 散乱体
 - 32 レーザ駆動回路(温度制御手段)
 - 33 半導体レーザ (温度上昇手段)
 - 37 再生回路(再生手段)
 - 41 磁気ヘット駆動回路 (磁界発生手段)
- * 42 磁気ヘッド (磁界発生手段)

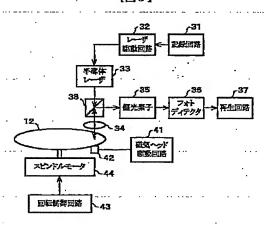
·【図1】



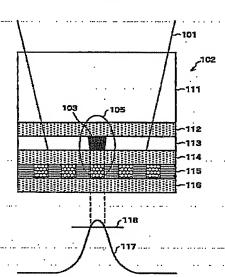
【図2】



[図3]



[図4]



フロントページの続き

(72)発明者 富永 淳二

茨城県つくば市東1-1-4 工業技術院

產業技術融合領域研究所内

(72)発明者 金 朱鎬

茨城県つくば市東1-1-4 工業技術院

産業技術融合領域研究所内

(72)発明者 阿刀田 伸史

茨城県つくば市東1-1-4 工業技術院

産業技術融合領域研究所内

(72) 発明者 薛 寬

茨城県つくば市東1-1-4 工業技術院

产業技術融合領域研究所内

(72)発明者 片山 博之

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

Fターム(参考) 5D029 JC09 MA27 MA39

5D075 AA03 EE03 FG02 FG10